

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 4 月 26 日 (26.04.2001)

PCT

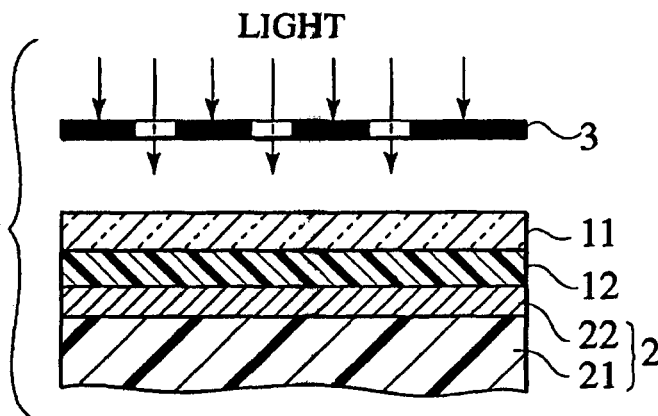
(10) 国際公開番号
WO 01/29616 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G03F 7/004, 特願平 11/307947
C08L 61/34, 61/28, 101/12 1999 年 10 月 29 日 (29.10.1999) JP
特願平 2000-196492
(21) 国際出願番号: PCT/JP00/07380 2000 年 6 月 29 日 (29.06.2000) JP
(22) 国際出願日: 2000 年 10 月 23 日 (23.10.2000) (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.)
(25) 国際出願の言語: 日本語 [JP/JP]; 〒163-0449 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
(26) 国際公開の言語: 日本語 Tokyo (JP).
(72) 発明者; および
(30) 優先権データ: (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐藤邦明
特願平 11/300995 1999 年 10 月 22 日 (22.10.1999) JP (SATOU, Kuniaki) [JP/JP]. 沓名貴彦 (KUTSUNA,
特願平 11/307516 1999 年 10 月 28 日 (28.10.1999) JP Takahiko) [JP/JP]. 吉野利純 (YOSHINO, Toshizumi)
特願平 11/307946 1999 年 10 月 29 日 (29.10.1999) JP [JP/JP]. 平山隆雄 (HIRAYAMA, Takao) [JP/JP]. 鵜沢
幹夫 (UZAWA, Mikio) [JP/JP]; 〒314-0255 茨城県鹿島
郡波崎町大字砂山5-1 日立化成工業株式会社 山崎
事業所内 Ibaraki (JP).

[続葉有]

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PHOTSENSITIVE ELEMENT USING THE SAME, METHOD FOR PRODUCING RESIST PATTERN, RESIST PATTERN AND SUBSTRATE HAVING THE RESIST PATTERN LAMINATED THEREON

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、これを用いた感光性エレメント、レジストパターンの製造法、レジストパターン及びレジストパターン積層基板



(57) Abstract: A photosensitive resin composition comprising (A) a photosensitive resin (B) a photopolymerization initiator and (C) a flame retardant, wherein the flame retardant contains a halogen atom or antimony atom in an amount of 5 wt % or less; a photosensitive element using the resin composition; a method for producing a resist pattern using the resin composition; a resist pattern using the resin composition; and a substrate having the resist pattern laminated thereon.

(57) 要約:

(A) 感光性樹脂、(B) 光重合開始剤及び (C) 難燃剤を含有してなり、前記難燃剤化合物中のハロゲン原子又はアンチモン原子の含有量が 5 重量 % 以下である感光性樹脂組成物、ならびに、これを用いた感光性エレメント、レジストパターンの製造法、レジストパターン及びレジストパターン積層基板を開示する。



(74) 代理人: 三好秀和(MIYOSHI, Hidekazu); 〒105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階
Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL,
IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU,
LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL,
PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW,
MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。